

簡歷

姓 名： 江國誠

性 別： 男

出生日期： 中華民國六十七年一月二十四日

籍 貫： 台灣省 台中縣

地 址： 台北市北投區承德路七段 280 巷六弄七號三樓

學 歷： 國立交通大學 材料科學與工程學系(民國 91 年 6 月)

國立交通大學 電子研究所固態組 碩士班

(民國 92 年 6 月)

論文題目： 銻金屬, 鈰金屬閘極絕緣層及複晶矽氮氧化層之研究

The Study of Cerium-based Gate Dielectrics, Hafnium-based Gate Dielectrics, and Interpoly oxynitride

電子郵件： gorden.ee91g@nctu.edu.tw

Publication List

International Letter

1. Jer Chyi Wang, **Kuo Cheng Chiang**, Tan Fu Lei, and Chung Len Lee,” Characteristics Improvement and Carrier Transportation of CeO₂ Gate Dielectrics with Rapid Thermal Annealing,” submitted for Electrochemical and Solid-State Letters 2004

International Conference

1. Jer Chyi Wang, **Kuo Cheng Chiang**, Tan Fu Lei, and Chung Len Lee,” Characteristics Improvement and Carrier Transportation of CeO₂ Gate Dielectrics with Rapid Thermal Annealing,” accepted for publication in the *2004 IPFA Proceedings of the 11th International Symposium on the July 2004*

2. **Kuo Cheng Chiang**, Jer Chyi Wang, and Tan Fu Lei,” Characteristics of Ultra-Thin Cerium Dielectrics with Rapid Thermal Annealing,” *WSEAS transactions on electronics, issue1, vol.1, Jan.2004*

3. **Kuo Cheng Chiang**, Jer Chyi Wang, and Tan Fu Lei, “Current Transportation of Ultra-Thin Cerium Dielectrics with Rapid Thermal Annealing,”